

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 2 区分

【発行日】平成 18 年 1 月 5 日 (2006.1.5)

【公表番号】特表 2005-514364 (P2005-514364A)

【公表日】平成 17 年 5 月 19 日 (2005.5.19)

【年通号数】公開・登録公報 2005-019

【出願番号】特願 2003-545638 (P2003-545638)

【国際特許分類】

C 0 7 D 301/06 (2006.01)

C 0 7 D 303/04 (2006.01)

B 0 1 J 29/89 (2006.01)

C 0 7 B 61/00 (2006.01)

【F I】

C 0 7 D 301/06

C 0 7 D 303/04

B 0 1 J 29/89 Z

C 0 7 B 61/00 3 0 0

【手続補正書】

【提出日】平成 17 年 9 月 26 日 (2005.9.26)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

改質剤および貴金属とチタンゼオライトを含む触媒の存在下に、オレフィン、酸素および水素を反応させることを含むエポキシドの製造方法であって、改質剤が (a) 二酸化炭素と共の炭酸カルシウムまたは (b) 炭酸水素アンモニウムであることを特徴とするエポキシドの製造方法。

【請求項 2】

チタンゼオライトがチタンシリカライトである請求項 1 に記載の エポキシドの製造方法。

【請求項 3】

チタンゼオライトが TS - 1 である請求項 1 に記載の エポキシドの製造方法。

【請求項 4】

触媒が貴金属を 0.01 ~ 10 質量% 含む請求項 1 に記載の エポキシドの製造方法。

【請求項 5】

貴金属がパラジウムである請求項 1 に記載の エポキシドの製造方法。

【請求項 6】

オレフィンが C₂ ~ C₆ オレフィンである請求項 1 に記載の エポキシドの製造方法。

【請求項 7】

オレフィンがプロピレンである請求項 1 に記載の エポキシドの製造方法。

【請求項 8】

改質剤が二酸化炭素と共の炭酸カルシウムである請求項 1 に記載の エポキシドの製造方法。

【請求項 9】

改質剤が炭酸水素アンモニウムである請求項 1 に記載の エポキシドの製造方法。

【請求項 10】

さらにメタノール、エタノール、イソプロパノールおよび *tert*-ブタノールからなる群より選ばれた溶媒および水を含む請求項 1 に記載の エポキシドの製造方法。

【請求項 11】

炭酸水素アンモニウムおよびパラジウムとチタンシリカライトを含む触媒の存在下に、溶媒中、プロピレン、水素および酸素を反応させることを含む エポキシドの製造方法。

【請求項 12】

チタンシリカライトが TS - 1 である請求項 11 に記載の エポキシドの製造方法。

【請求項 13】

触媒がパラジウムを 0.01 ~ 10 質量% 含む請求項 11 に記載の エポキシドの製造方法。

【請求項 14】

溶媒がメタノール、エタノール、イソプロパノール、*tert*-ブタノールおよび水からなる群より選ばれる請求項 11 に記載の エポキシドの製造方法。

【請求項 15】

改質剤およびパラジウムとチタンシリカライトを含む触媒の存在下に、溶媒中、プロピレン、水素および酸素を反応させることを含む エポキシドの製造方法 であって、改質剤が二酸化炭素と共の炭酸カルシウムであることを特徴とする エポキシドの製造方法。

【請求項 16】

チタンシリカライトが TS - 1 である請求項 15 に記載の エポキシドの製造方法。

【請求項 17】

触媒がパラジウムを 0.01 ~ 10 質量% 含む請求項 15 に記載の エポキシドの製造方法。

【請求項 18】

溶媒がメタノール、エタノール、イソプロパノール、*tert*-ブタノールおよび水からなる群より選ばれる請求項 15 に記載の エポキシドの製造方法。